

ALDにおけるプリカーサーの 吸着・解離プロセス

産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、北海道大学、量子科学技術研究開発機構は、文部科学省委託事業「マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）」の一環として、2026年度第1回ARIM量子・電子マテリアル領域セミナー『ALDにおけるプリカーサーの吸着・解離プロセス』を、2026年7月29日（水）にハイブリッドで開催いたします。

ARIM事業では、これまでの共用施設利用に加えて利用結果のデータベース化とそれらのデータの利活用が大きな事業目標となっています。セミナーの最後に、これまでにARIMで蓄積されているARIMデータベースの閲覧方法やデータカタログの一部を紹介いたします。また、LLMを利用したデータ検索エージェントによるALD関連データの検索デモを実施いたします。

◇概要

【日時】 令和8年7月29日（水）12:55～17:00

【開催方法】 現地参加（産総研中央事業所2-12棟）とTeams配信によるハイブリッド開催（URLは開催日までに連絡致します）

【参加費】 無料

【定員】 現地参加60名、オンライン参加200名
（先着順、参加登録をお願いします）

【セミナー案内/申し込み】 <https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2026-1/>

【問い合わせ】 tia-npf-school1@aist.go.jp

◇講演プログラム

12:50-13:00 はじめに 産総研ナノプロセッシング施設運営室 松本 壮平

13:00-13:30 ALD-SiO₂におけるTDMAS原料の吸着へ下地酸化物が及ぼす影響
物質・材料研究機構 生田目 俊秀

13:30-14:00 各種基板表面上へのプリカーサーの吸着選択性の理解
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社 林 元輝

14:00-14:30 ALD成膜におけるプリカーサーの配位子効果
株式会社 東ソー 徳留 功一

14:30-15:00 In-situ XPSによる、アミノシラン前駆体の吸着分解過程の観察
東北大学流体科学研究所 遠藤 和彦

(裏面へ続く)

◇講演プログラム(続き)

15:00-15:20 休憩

15:20-15:40 産総研NPFのALD実験環境

産総研ナノプロセッシング施設運営室 山崎 将嗣

15:40-16:10 プリカーサー吸着へのシミュレーション適用

北海道大学グリーンナノテクノロジー研究センター 松尾 保孝

16:10-16:20 放射光X線による半導体成膜過程のin-situ測定

量子科学技術研究開発機構 佐々木 拓生

16:20-16:30 NIMS微細加工共用施設のALD装置紹介

NIMS 技術開発・共用部門 微細加工ユニット 津谷 大樹

16:30-17:00 ALDデータの活用のご紹介～ARIMデータ共用サービスとAI検索ツールのご案内

物質・材料研究機構 ARIMセンターハブ 桑田 武

【主催】産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設運営室(NPF)

【共催】北海道大学グリーンナノテクノロジー研究センター

【共催】量子科学技術研究開発機構(QST)放射光科学研究センター

【共催】物質・材料研究機構 ARIMセンターハブ担当領域推進室

お問い合わせ: tia-npf-school1@aist.go.jp